

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 5 月 17 日 (2007.5.17)

【公開番号】特開 2005-330239 (P2005-330239A)

【公開日】平成 17 年 12 月 2 日 (2005.12.2)

【年通号数】公開・登録公報 2005-047

【出願番号】特願 2004-151126 (P2004-151126)

【国際特許分類】

C 0 7 C 51/09 (2006.01)

C 0 7 C 61/09 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 0 7 C 51/09

C 0 7 C 61/09

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 3 月 23 日 (2007.3.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

水溶液中で 1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸ジアルキルを酸性触媒存在下に加水分解反応させて 1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸を得る方法であって、水及び加水分解反応中に副生するアルコールを反応系外に連続的に蒸発させながら、水を反応系に連続的又は間欠的に添加して加水分解反応させることを特徴とする 1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸の製造方法。

【請求項 2】

液空間速度が、反応液容量を基準として 0.2 ~ 0.05 / h になるように水を添加して反応させる請求項 1 に記載の 1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸の製造方法。

【請求項 3】

1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸ジアルキルが、テレフタル酸ジアルキルの核水素化反応により製造されたものである請求項 1 又は 2 に記載の 1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸の製造方法。

【請求項 4】

1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸ジアルキルが、1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸ジメチルである請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の 1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸の製造方法。

【請求項 5】

加水分解反応後の 1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸中の有機不純物の含有量が 0.1 重量% 以下であることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の 1, 4 - シクロヘキサンジカルボン酸の製造方法。